PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003121791 A

(43) Date of publication of application: 23.04.03

(51) Int. CI

G02B 27/28

(21) Application number: 2001317830

(22) Date of filing: 16.10.01

(71) Applicant:

SONY CORP

(72) Inventor:

SUGANUMA HIROSHI

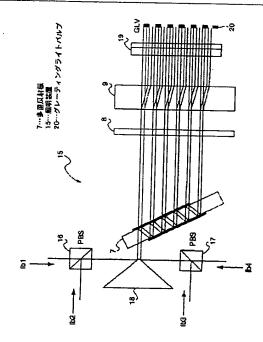
(54) ILLUMINATION DEVICE USING A PLURALITY OF BEAMS AND IMAGE DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make uniform the intensity distribution of an illumination device using light beams from a plurality of lasers.

SOLUTION: The illumination device 15 concerned with a grating light valve 20 divides the light beams from the plurality of the lasers into a plurality of beams having equal intensity. The divided beams having the equal intensity are spatially shifted by using birefringence and beams having no coherence are put one over another to obtain illumination light having a uniform intensity distribution. As a means for intensity division, a style using multiple reflection and a style using polarization are available, but the former style can increase the number of beam divisions and is advantageous in cost.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-121791 (P2003-121791A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

(51) Int.Cl.7

G02B 27/28

識別記号

FI G02B 27/28

テーマコード(参考)

Z 2H099

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 17 頁)

(21)出顧番号

特顯2001-317830(P2001-317830)

(22)出顧日

平成13年10月16日(2001.10.16)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 菅沼 洋

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100069051

弁理士 小松 祐治

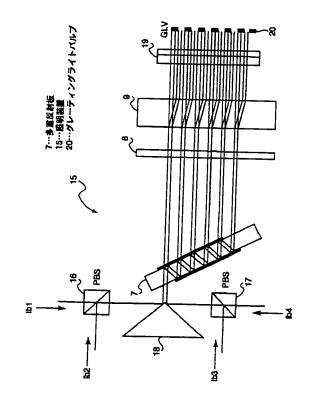
Fターム(参考) 2H099 AA11 BA09 BA17 CA06 DA09

(54) 【発明の名称】 複数のビームを用いた照明装置及び画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 複数のレーザーからの光線を用いた照明装置において、強度分布を均一化する。

【解決手段】 グレーティングライトバルブ20に関する照明装置15において、複数のレーザーからの光線を、強度の等しい複数のビームに分割する。そして、分割された等強度のビームに対して、複屈折を用いてビームを空間的にずらして、可干渉性をもたないビーム同士を重ね合わせることによって、均一な強度分布をもった照明光を得る。強度分割の手段には多重反射を利用した形態と、偏光を利用した形態があるが、前者の形態では、ビーム分割数を多くでき、コスト面でも有利である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のレーザーからの光線を用いて均一 化された強度分布が得られるように構成された、複数の ビームを用いた照明装置において、

複数のレーザーからの光線を、強度の等しい複数のビームに分割してから、複屈折を用いてビームを空間的にずらした上で重ね合わせるようにしたことを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項2】 請求項1に記載した複数のビームを用いた照明装置において、

複数のレーザーからの光線を、多重反射板によって複数 のビームに分割するとともに、それらのビームを、複屈 折性結晶を含む光学系に通した上で重ね合わせるように したことを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項3】 請求項1に記載した複数のビームを用いた照明装置において、

複屈折後に得られる複数のビーム配置が空間的に周期性をもっており、コヒーレントな関係にある2つのビームの間に、インコヒーレントな関係をもつ複数のビームが配列されるとともに、あるビームを中心としてこれに隣 20 接する1周期内のビームが当該中心のビームと干渉しない配置とされていることを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項4】 請求項3に記載した複数のビームを用いた照明装置において、

1周期分を構成する複数のビームが、異なるレーザーからの光であってかつ異なる偏光状態とされることを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項5】 請求項1に記載した複数のビームを用いた照明装置において、

レーザー光源として、半導体レーザーアレイ及びマイクロレンズアレイを用いたことを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項6】 請求項1に記載した複数のビームを用いた照明装置において、

入射される各ビームの強度分布がほぼガウシアン分布を有しており、最終的に並列配置されるビームについて隣接するビームの中心間隔が、ガウシアンビーム半径のほぼ1倍乃至1.5倍の範囲に規定されていることを特徴とする複数のビームを用いた照明装置。

【請求項7】 複数のレーザーからの光線を用いて均一 化された強度分布が得られるように構成された照明装置 と、これによって照明される空間変調器を用いた画像表 示装置において、

複数のレーザーからの光線を、強度の等しい複数のビームに分割してから、複屈折を用いてビームを空間的にずらした上で重ね合わせ、それにより均一化された光が上記空間変調器に照射されることを特徴とする画像表示装置。

【請求項8】 請求項7に記載の画像表示装置におい

て、

複数のレーザーからの光線を、多重反射板によって複数 のビームに分割するとともに、それらのビームを、複屈 折性結晶を含む光学系に通した上で重ね合わせるように したことを特徴とする画像表示装置。

【請求項9】 請求項7に記載の画像表示装置において、

空間変調器としてグレーティングライトバルブを用いた ことを特徴とする画像表示装置。

10 【請求項10】 請求項8に記載の画像表示装置において、

空間変調器としてグレーティングライトバルブを用いた ことを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数のレーザービームを用いた照明装置において強度分布の均一化を実現するための技術に関する。

[0002]

20 【従来の技術】プロジェクションディスプレイと称する
画像表示装置では、空間変調器として液晶パネルや、D
MD (Digital Micromirror Device) 等が用いられてき
たが、近時、マイクロマシン技術によるアクティブ駆動
式のグレーティング (回折格子) を用いたディスプレイ
が開発されて注目を集めている。使用する回折格子型素
子の名前は、「グレーティングライトバルブ (Grating
Light Valve)」(以下、「GLV」と略記する。)と
呼ばれ、従来の空間変調器を使った場合に比べて、継ぎ
目のない(シームレス)鮮明で明るい画像を表示できる
30 こと及びマイクロマシン技術を用いて安価なコストで作
成できること、そして、高速動作が可能であること等の
特長を有している。

【0003】このGLVを用いて画像を形成するには、回折光のうち、0次光を遮光して、±1次光だけを透過させるシュリーレンフィルタリングが必要である。

【0004】図13はシュリーレンフィルター光学系 a の要部について示したものである。図示しない光源からの光が、シリンドリカルレンズL0により集光されてG LVに照射され、その回折光がレンズL1、シュリーレ ンフィルターF、レンズL2をこの順で透過して出射される。

【 0 0 0 5 】尚、図中に示す光線「l t (+1) 、l t (0) 、l t (-1) 」はG L Vによる回折光を表して おり、「l t (+1)」が+1次回折光、「l t

(0)」が0次(回折)光、1t(-1)が-1次回折 光をそれぞれ示しており、シュリーレンフィルタリング により0次光だけが遮光される。

【0006】GLVとしては反射型の素子が用いられて おり、メンプレンと呼ばれる多数の微小リボンがエアギ 50 ャップをもって基板上に並列配置された構成を有してい る。そして、GLVの状態のうち、第一の状態(ピクセル消灯時)では全てのリボンの位相が揃えられる結果、 ±1次回折光は発生しない(反射光のみ)が、第二の状態(ピクセル点灯時)では、リボンが1つおきに静電気力により基板側に引き付けられて反射型回折格子が形成される結果、±1次回折光が発生する。そして、この±1次回折光のみを選択するために、GLVのフーリエ面で空間的フィルタリング(シュリーレンフィルタリング)を行うことが必要とされる。

【0007】尚、ここで、フィルタリングのコントラス 10トを上げるためには、入射光線の回折方向の角度範囲を充分に狭くしておくことが必要である。これは、入射光線が広がりをもっていると、フィルタリング面上での光線入射値について広がりができるため、消光時に漏れ光が生じてしまうためである。

【0008】図14は上記光学系 a のうち、G L V とレンズL 1、そしてシュリーレンフィルター面Fだけを取り出して示したものであり、±1次回折光がフィルタリングにより選択される様子について概念的に示している(但し、G L V については図示の便宜上、透過型素子として示している。)。

【0009】このような光学系に対する光源として、例えば、レーザーディスプレイ等のようにレーザーを用いた場合には、スペックル (あるいはスペックルノイズ)が問題視される。尚、スペックルは、レーザーからの位相の揃ったコヒーレント光がランダムな位相面によって散乱されることにより、物体での隣接した領域からの乱れた波面が観察面上で干渉することに起因する現象である。そして、粒状の光強度分布となって現出するスペックルノイズを低減するための技術が必要不可欠とされる。特に、スペックルがスクリーンと観察者の目、つまり網膜との間で生じることが、レーザーディスプレイにおいては問題になる。

【0010】また、照明の均一性については、照明光学系一般に要求されるために各種の方法が提案されており、例えば、下記の方法が挙げられる。

【0011】(A) ビーム走査 (スキャニング) による 方法

(B) 強度分布の変換による方法。

【0012】先ず、(A) については、例えば、ガウシアンビーム (光強度分布がガウス分布に従うビーム) から均一な強度分布を得るために、図15に示すように、複数のビームを並列に配置し (この例では5個)、その並列化の方向にビーム走査するのではなく、当該方向に対して傾けた方向にビーム走査を行う方法が挙げられる。図には、5つの円で示すビームが左斜め上方から右斜め下方に配列されており、個々のビームについては、それぞれの左下に示すように、ガウシアン分布をもっている。そして、ビームの走査方向は、それぞれの矢印で示すように、図の左方から右方に向かう方向となるよう

に規定されているので、右側に示すグラフ図のように各ビームの分布曲線(破線で示す。)を合成した強度分布(実線で示す。)を得ることができる。尚、この方法はレーザー加工や露光等、露光量の積分値について均一性が求められる用途で一般に良く用いられている。隣接するコヒーレントなビーム同士が重なり合えば干渉が生じるので、強度分布は不均一になるが、総露光量についちの均一化が求められる場合には、全てのビームが離れた配置を採れる)ので、このような方法でも問題ない。【0013】上記(B)については、例えば、非球面シリンドリカルレンズを用いて強度分布を変換する方法がラン分布の入力ビームに対してプロファイル変換を行って均一な強度分布を得るものである。

【0014】尚、このような照明又は露光用には、異なる複数の光源を起源とするレーザービームを用いる形態と、レーザー光について強度分割を行うことで複数のビームを生成する形態とが挙げられ、以下では、後者を実20 現するための要素技術として知られている下記事項について説明する。

【0015】(1)偏光による強度分割

(2) 多重反射による強度分割。

【0016】先ず、(1)の偏光を利用する場合について説明するが、その際には入射レーザー光について直線偏光を想定する。

【0017】図16に示す構成例bのように、2/2波 長板(2分の1波長板)と、複屈折性結晶を配置した光 学系に、図示しない光源からのレーザー光を入射させる 30 場合について考える。尚、図中の「1t1」は入射光、 「1t2」が波長板の透過光、「1t3」が複屈折性結

11 t 2 」が液長板の透過光、「1 t 3 」が複屈折性結晶の透過光をそれぞれ示しており、それらの光については図の下方に示すように、両向き矢印によって偏光状態(偏光方向)をそれぞれ示している。

【0018】適当な方位に切断した複屈折性結晶に対して、1/2波長板により偏光方向を適当な方位に回転させたレーザー光(図の「1 t 2」)を入射させれば、直交する偏光(つまり、直交関係にある2つの偏光)はでは、直交する偏光(つまり、直交関係にある2つの偏光)は、強度の等しい2つの偏光(図の「1 t 3」を参照。)をもつビームを生成することができる。尚、これでは、説明の便宜上、直交する2つの直線偏光への分離方法について述べたが、これに限らず右回りと左に対りでは誘電体結晶や液晶等が知られているが、使用する波長に対して透過率が高く、かつ十分な分離角を実用的な厚みで得られるものを選定することが好ましい。【0019】このような目的のために作成された偏光光

いる。そして、ビームの走査方向は、それぞれの矢印で 学素子としては、ビオ=サバールの発明したサバール板 示すように、図の左方から右方に向かう方向となるよう 50 が挙げられ、これは、光学軸に対して45 の方位をも

って切り出された1軸性結晶を、平行平板として研磨したものである。サバール板に対して垂直に入射した光は、複屈折によって、互いに直交する偏光(常光線と異常光線)に分離されるが、両光線については結晶中の伝搬方向(つまり、エネルギー流の伝播方向を示すポインティングベクトルの方向)が異なるため、結晶中を伝搬するにつれて光線が分離される。但し、入射光線が垂直入射する場合には、結晶中でも出射後においても、波面の法線方向が常にサバール板に対して垂直であり、従って、垂直入射した光線は、互い直交関係をもつ2偏光に 10分離されて同じ方向に出射されることになる。

【0020】このときの、2偏光のシフト量(あるいは位置ずれ量であり、これを「d」と記す。) は次式で与えられる。

[0021]

【数1】

$$d = t \cdot \tan \phi = t \cdot \frac{\left(n_o^2 - n_e^2\right) \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta}{n_e^2 \cdot \cos^2 \theta + n^2 \cdot \sin^2 \theta}$$

【0022】尚、上式中で用いた各記号の意味は下記の 20 通りである。

【0023】 t;結晶の厚み

φ;直交する2偏光についての結晶中の分離角

n。; 1 軸性結晶の常光線屈折率

ne; 1 軸性結晶の異常光線屈折率

 θ ; サバール板の入射面法線と光学軸との間になす角度。

【0024】例えば、分離角を最大にするために、 $\theta=45$ とし、1 軸性結晶として方解石を用いる場合に、 $n_0=1$. 658、 $n_0=1$. 486 の各数値を上式に代 30 入することで、タンジェント項として t an $\phi=0$. 1 09を得る。よって、t=10 mm(ミリメートル)とすると、d=1. 09 mmのシフト量をもって分離された出射光線を得ることができる。

【0025】複屈折を用いた偏光分離のための素子には、ウォラストンプリズム等の様々なタイプの素子が知られているが、入射光と出射光(常光線及び異常光線)の各方向を全て一致させることが必要な場合には、サバール板又はその改良品を用いるのが好ましい。尚、サバール板についてはこれを単体で使用する例と、その変形例として、サバール板を何枚も重ね合わせたもの等が良く用いられるが、その機能としては同じである(よって、以下の説明では、「サバール板」の概念には、複数枚の構成をも含めることにする。)。また、上記の数値例では方解石を挙げたが、これは天然の複屈折材料であって大型で良質のものを採掘するのが困難であるために高価である。そこで、低コスト化のためには、人工水晶等の安価な結晶を用いる必要がある。

【0026】次に、上記(2)の多重反射を用いた分割 方法について説明する。 【0027】図17は、多重反射板cの構成例について示したものである。

【0028】平行平板の片面(図の左面)には、光線入射用の窓部Wを除いて、全反射コート(強度反射率を「R」とする。)が施されている。これに対して、反対側の面(図の右面)には、多重反射の回数と位置に応じて、分割された複数の領域が設けられている。本例では、6つに分割された領域についてそれぞれに異なる強度反射率(これらをそれぞれ「R1、R2、…、R6」とする。)のコーティングが施されている(尚、後述するように、「R6=0」としているので図に示す分割数は5である。)。

【0029】図中に示す6本の光線「 $1t_n$ 」(n=0、 $1\sim5$)は出射光線をそれぞれ示しており、添え字の「n」は出射面側での反射回数に相当する。

【0030】説明を簡単化するために、窓部Wについては強度損失がないものと仮定する(反射率0) と、各ビームの出射強度(入射強度を「1」とする。) は下記のようになる。

【0031】・「 lt_0 」に示すビーム(出射面側での反射なしに出射するビーム)の強度=「 $l-R_1$ 」

- ・「1 t $_$ 1 」 に示すビーム(出射面側で1 回反射した後に出射するビーム)の強度= 「R \cdot R_1 \cdot (1 R_2)」
- ・「 $1 t_2$ 」に示すビーム(出射面側で2回反射した後に出射するビーム)の強度=「 $R^2 \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot (1-R_3)$ 」
- ・「1 t $_$ 3」に示すビーム(出射面側で3回反射した後に出射するビーム)の強度=「 R^3 ・ R_1 ・ R_2 ・ R_3 ・(1 R_4)」
- ・「lt_4」に示すビーム(出射面側で4回反射した 後に出射するビーム)の強度=「R⁴・R₁・R₂・R₃・ R₄・(1 - R₅)」
- ・「1 t _ 5」に示すビーム(出射面側で5回反射した 後に出射するビーム)の強度=「R⁵・R₁・R₂・R₃・ R4・R5・(1 - R6)」。

【0032】つまり、N回の反射後に出射するビームの 強度は、RのN乗と、それまでに反射が行われた領域に 亘る反射率の積、そして、出射領域の透過率を掛け合わ せたものに等しい。

【0033】今、6本のビームを生成するものとして、 損失が最低であるためには6番目の領域についてARコートをすることが好ましいが、以下に示す計算上、「R6=0」とし、「R=1」と仮定する。また、平行平板 内部での吸収や散乱を無視できるとすれば、全ビームの 強度和が1に等しいという等値関係から下式が得られる。

J. B. Williams

【0034】 【数2】

50

特開2003-121791

 $(1-R_1)+R_1\cdot (1-R_2)+R_1\cdot R_2\cdot (1-R_3)+R_1\cdot R_2\cdot R_3\cdot (1-R_4)$ $+R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot (1-R_3) + R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot R_3 = 1$

【0035】また、全てのビームについて、それらの強 度を等しくすることが目的であるので、下式とおく (つ まり、 [数2] 式における左辺の各項の値が全て等しい ものとする。)。

[0036]

【数3】

 $1 - R_1 = R_1 \cdot (1 - R_2) = R_1 \cdot R_2 \cdot (1 - R_2) = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot (1 - R_4)$

 $= R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot (1 - R_3) = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot R_5 = \frac{1}{6}$ 10

$$R_1 = \frac{5}{6}$$
 $R_2 = \frac{4}{5}$ $R_3 = \frac{3}{4}$ $R_4 = \frac{2}{3}$ $R_5 = \frac{1}{2}$

【0039】このような反射率をもつ各反射膜を、所望 の波長及び入射角に対して設計し、平行平板に対する成 膜工程を経て形成すれば良く、そのためにはマスキング と反射コーティングの作業を繰り返すだけで済むので比 較的コストのかからない方法で実現できる。尚、平行平 板の厚みについては、入射ビーム径に対して多重反射光 の間隔を十分に取れるようにする。

【0040】上記のようなビームの等強度分割によらず に、複数のレーザーを用いる場合(例えば、高輝度化の 要請を受けてレーザーディスプレイ等でレーザーの高出 力化を実現させたい場合等)には、各レーザーによるビ 一ムを要領よくコンパクトに合波することが必要であ る。また、複数のレーザーの使用は、各レーザー光がイ ンコヒーレントな関係にあるため、上記したスペックル ノイズについてのコントラスト低減にもつながるので有 効である。

[0041]

【発明が解決しようとする課題】ところで、レーザーを 光源とする照明装置に要求される事項として、照明の均 一性が高いこと、平行光が得られること、スペックルノ イズがないこと(又は目立たないこと)が挙げられる が、従来の照明装置にあってはこれらの事項の中でも、 特に均一性について充分に満足のいく特性が得られない か又は所望の特性を得るまでに費やす労力の負担が大き いことが問題となっている。

【0042】例えば、前記した方法(A)について、レ ーザービームを空間的に合波しようとすれば、必然的に ビーム間にギャップ(強度分布において低い部分)が生 じるので、このままではGLVのような線状領域を、隈 無く多数の平行光で分割して同時に照明することは困難 である。また、方法(B)において、非球面レンズ等を 用いる場合には、一般に非球面シリンドリカルレンズに ついての設計、製造、評価が技術的に難しいことが問題 とされていることからも分かるように、その代替技術が 求められている。

【0043】尚、均一性が悪いと効率の低下に繋がり、

*【0037】つまり、[数2]式において各ビームが等 しい強度(1/6)をもつことから、〔数3〕式を用い て各反射率を順次に求めていくことにより、最終的に下 式を得る。

[0038] 【数4】

レイ装置等ではダイナミックレンジを充分にとれなくな る等の弊害をもたらす虞がある。

【0044】そこで、本発明は、複数のレーザーからの 光線を用いた照明装置において、強度分布の均一化を実 現することを課題とする。

[0045]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記した課題 を解決するために、複数のレーザーからの光線を、強度 の等しい複数のビームに分割してから、複屈折を用いて ビームを空間的にずらした上で重ね合わせることで、均 一化された光強度分布が得られるように構成したもので ある。

【0046】従って、本発明によれば、分割された強度 の等しい複数のビームに対して、複屈折を用いてビーム を空間的にずらして、可干渉性をもたないビーム同士を 重ね合わせることによって、均一な強度分布をもった照 30 明光を得ることができる。

[0047]

【発明の実施の形態】本発明は、複数のレーザーからの 光線を用いるとともに、均一化された光強度分布の照明 光を得るための光学的構成に関するものである。例え ば、画像表示装置への適用においては、フロントプロジ エクション(前面投射)型、リアプロジェクション(背 面投射)型のレーザーディスプレイ等が挙げられるが、 その他、レーザープリンタ、あるいはディジタル画像デ 一夕から映画フィルムへの記録装置等、印刷や記録を含 む画像装置に広く用いることができる。勿論、レーザー 核融合、レーザーアニーリング等の加工や計測等の用途 において均一照明光を必要とする場合に適用することで 精度等の向上に寄与することが可能である。

【0048】本発明に係る照明装置の具体的な構成につ いて説明する前に、本発明の基本原理について説明す

【0049】先ず、複数のレーザーからの光線を用いる ことが前提とされる。これは、高輝度化の他、スペック ルノイズの低減にも有効である。また、レーザー光の強 高輝度化等への支障を来す原因となり、また、ディスプ 50 度がほぼ等しくなるように合わせておくことが好まし

い。

【0050】そして、強度の等しい複数のビームに分割 する手段をもつこと及び分割後には1回又は複数回の複 屈折を用いてビームを空間的にずらした上で重ね合わせ ることが基本的事項である。即ち、並列化された複数の ビームに対して、複屈折を利用してビームを空間的にシ フトさせながら強度分割し、隣接した可干渉性をもたな いビーム同士が空間的に重なり合うようにすることで、 均一な強度分布を生成することができる。このような照 明光を、例えば、GLV等の線状領域に対して照射する ことにより均一な照明を行えるが、1次元照明(線状照 明)に限らず2次元の均一照明への適用が可能である。

【0051】ビームの重ね合わせによる均一化方法につ いては、重ね合わせに求められる条件についての考察を 要する。尚、以下の説明では主にガウシアンビームを想 定して説明するが、より一般的な強度分布をもつレーザ 一光についても、以下に示す考え方を適用できることは 勿論である。

【0052】複数のインコヒーレントかつ等強度のガウ シアンビームを空間的に併置したときの強度分布例につ 20 いて示したものが図1及び図2である。

【0053】これらの図においては、ガウシアンビーム のビーム半径(強度がピーク値の e⁻²になるときの 値。)を「1」とした場合における、各ビームの中心間 隔(これを「S」と記す。)を変化させたときの様子を 示しており、横軸にビームの配置方向における相対座標 (ビーム半径を「1」とする。)をとり、縦軸に相対強 度をとっている。

【0054】図1では、ビームの中心間隔がS=2の状 態から、S=1. 5、S=1. 4、S=1. 3、S=1 30へと次第に狭まっていく場合の重なり具合をそれぞれ示 している。尚、本図では9本のビームの強度和について 実線で示し、個々のビームの強度については破線で示す ことで両者の分布を区別している。

【0055】また、図2では、ビームの中心間隔をS= 2の状態から0.2刻みでS=1の状態まで順次に狭く していったときの様子を示しており、各状態のグラフ曲 線(強度分布曲線)を1つにまとめて示したものであ

【0056】図から分かるように、ビームの重ね合わせ 40 によって総強度分布が均一化されることが分かるが、S 値が1.5以上ではビーム間に強度の不均一性が次第に 目立つようになる。つまり、S値の増加につれて強度分 布における山谷の差が大きくなる傾向が認められる。

【0057】また、S値が小さくなると、中心部での均 一性が向上する。しかし、S値が小さくなっていくと、 均一な部分の幅(図1や図2に示すグラフ図の横軸方向 の幅)が相対的に狭くなる傾向が認められ、従って、強 度和を示す分布曲線において裾部分の強度が相対的に増

なると、裾部分の占める割合が相対的に大きくなるため である。)。実際に利用するのは強度分布において主に 均一な部分であるため、S値が小さすぎると光利用効率 の低下を招く原因となる虞がある。

【0058】以上の考察からビーム半径に対するS値と しては、1乃至1.5程度の範囲が実用上望ましいこと が分かる。尚、S=1やS=1.5についてはビームの 重ね合わせにおいて一応の目安となる値であり、従っ て、実際上はそれらの近傍値であっても構わない。

【0059】また、例えば、レーザーディスプレイ等の 照明用途としては、干渉による強度分布の不均一性は望 ましくないので、S値として約1乃至1. 5程度の範囲 において、隣接する左右それぞれ3本程度のビームにつ いて干渉が生じないようにすることが望ましい。例え ば、複数のビームのうちコヒーレントな関係にあるビー ムの中心間隔が全てガウシアンビーム半径の5倍(ピー ク4個分のビーム幅に相当する。) 以上となるように設 定して離隔させる。

【0060】GLVに係る照明光学系では、照明領域が GLV上の線上域に限られるので、前記方法 (A) のよ うに空間的にビームをずらしてスキャニングで重ね合わ せることができない。従って、例えば、あるビームを中 心として、当該ビームに隣接する左右3本(自分自身を 含めて計7本)のビームについては、下記の事項が必要 とされる。

【0061】(Ⅰ)直交関係にある偏光状態(直線偏 光)あるいは右回り、左回りの円偏光のビームを用いる こと

(II) 異なるレーザーからのビーム (起源をそれぞれ 異にするビーム)を用いること

(III) (I) 及び(II) の併用。

【0062】これにより、ビーム間で干渉が起こらない ようにすることができる。

【0063】また、レーザーディスプレイ等への適用に おいてはスペックルの問題があり、スペックルのコント ラストを低減させる上でも、上記 (I) 乃至 (III) が有効である。即ち、異なるレーザーのビームや、直交 する偏光のビームを重ね合わせることで、異なるスペッ クルパターンを平均化してスペックルコントラストを低 減させることができる。その際には可干渉性がないビー ム同士ができるだけ重なり合うようにしなければならな いので、例えば、上記のように、隣接する7本のビーム の非可干渉性(インコヒーレント)は均一性のみなら ず、スペックルコントラストの低減にも必要である。

【0064】尚、髙輝度化にとっては、できるだけ複数 のビームを用いることが好ましいが、スペックルのコン トラストを極力低減させるには、それらのビームを強度 分布変換系(本発明では強度分布を均一化させるための 光学系)に入射する以前に合波することが望ましい。即 加していくことが分かる(これは、均一部分の幅が狭く 50 ち、合波されたビームを1本のビームとみなせば、強度

分布の均一化に関しては上記の説明と同様に考えること ができるからであり、例えば、レーザーディスプレイ等 への適用においては、照明領域内の全ての点にできるだ け多くのインコヒーレントなビームが重ね合わされるよ うにすることが望ましい。

【0065】以上の事項を踏まえた上で、ビーム構成の 具体例を示すと次のようになる。

【0066】例えば、異なる2つのレーザー(第一レー ザー、第二レーザー)からのビームについてp偏光、s 偏光を想定した形態(異なるレーザーからの光及び異な 10 る偏光を利用した、上記 (I I I) の場合) において、 N番目に位置するビームが第一レーザーによるp偏光で あるとした場合には、下記のようになる。

【0067】・N+4番目のビーム=第一レーザーから

- ・N+3番目のビーム=第二レーザーからの s 偏光
- ・N+2番目のビーム=第一レーザーからの s 偏光
- ·N+1番目のビーム=第二レーザーからのp偏光
- ·N-1番目のビーム=第二レーザーからのp偏光
- ・N-2番目のビーム=第一レーザーからの s 偏光
- ・N-3番目のビーム=第二レーザーからのs偏光
- ・N-4番目のビーム=第一レーザーからのp偏光。

【0068】この配置では、N番目のビームである第一 レーザーによるp偏光を中心として、一方の傍らに「N +1」番目のビームが隣接され、さらにN+2乃至N+ 4番目の各ビームが位置されており、これらとは反対側 には、N番目のビームの傍らに「N-1」番目のビーム が隣接され、さらにN-2乃至N-4番目の各ビームが 位置されている。従って、N番目のビームに関して隣接 N-3番目の各ビーム)と、中心のビーム(N番目のビ ーム)とは干渉しないことが分かる。また、N-4番目 と、N+4番目の各ビームについては、中心のビームと 干渉し得るが、ビーム間隔が空間的に充分な距離をもっ ていて各ビームがほぼ分離されている場合には、干渉の 影響は軽微である。

【0069】以上のようなビーム群の配置、即ち、複屈 折後に得られる複数のビーム配置が空間的に周期性を有 すること、そして、コヒーレントな関係にある2つのビ ームの間にインコヒーレントな関係をもつ複数のビーム 40 が配列されるとともに、中心ビームに関して、これに隣 接する1周期内のビームが当該中心ビームと干渉しない 配置を採ることにより、均一かつ高効率であって、しか もスペックルコントラストを充分に抑えた照明光学系を 構成することができる。

【0070】尚、上記したビーム構成は、ほんの一例を 示すものであり、隣接するビーム同士の関係は、入射ビ ームの間隔や結晶のもつ複屈折量によって配置が変るこ 🖟 とがあるので、各種の実施形態が可能である。つまり、

び異なるレーザーからの1組の偏光(直交関係にある偏 光等)を用いて、隣接する左右3本ずつのビームを並列 配置した構成を採れば良い。上記の例では、N番目のビ ーム(中心ビーム)からN+4番目又はN-4番目のビ 一ムの間隔を一周期として繰り返す周期的配置がとられ ており、中心ビームとその直ぐ脇に隣接する別のレーザ 一からの p 偏光、さらに、中心ビームと同じレーザーか らの s 偏光、別のレーザーからの s 偏光によって構成さ れるビーム群を1単位する。ビーム配置の1周期につい ては、勿論、これに限らず各種配置のビーム群を用いる ことができる(例えば、左側又は右側に隣接する3本の ビーム配置あるいは、あるビーム自身とその左側又は右 側に隣接する3本のビームを含む、合計4本のビーム配 置についてビームを適宜に入れ替える等。)。 要は、あ るビームを中心とした所定本数のビームについて当該中 心のビームとの間に干渉が極力生じないようにし、スペ ックルコントラストを低減させつつ、均一な照明を行え るように配置することが重要である。

【0071】また、さらに多数のレーザーを用いること 20 により、例えば、平行平板等による強度分割の1単位と なるビーム数を増やすようにしても良いが、スペックル コントラストを考慮した場合には、各ビームをできるだ け重ね合わせることが好ましい。

【0072】次に、GLVに係る照明光学系において、 シュリーレンフィルタリングに関する注意点について説 明する。この光学系(図13参照)では、シュリーレン フィルタリングを行うために、強度分布変換後の光線の 角度について十分な注意が必要であり、シュリーレンフ ィルタリング後のコントラストを十分に高くとるために する3本のビーム(N+1 乃至N+3番目、N-1 乃至 30 は、GLVへの入射角度を ±0 . 3度以下程度にするこ とが実用上望ましい。

> 【0073】例えば、図3に示す構成を考えると、半導 体レーザーアレイとしてのLD (レーザーダイオード) アレイ (あるいはLDアレイバー) 1から発せられた光 線が、マイクロレンズアレイ2を用いてコリメートさ れ、その後に複屈折性結晶3、さらにはシリンドリカル レンズ4を経てGLV5に照射される。尚、LDアレイ 1は多数のエミッター(出射源あるいは放射源)を同一 基板において一列に配列させたものである。尚、図の下 方には、各エミッターから出射されてマイクロレンズア レイ2を透過した後(図の破線位置を参照)の各ビーム の強度分布(ガウシアンビームを仮定している。)と、 複屈折性結晶3を透過した直後の分布(図の破線位置で の分布であり、実線で示す分布曲線がp偏光に係る強度 分布を示し、一点鎖線で示す分布曲線が s 偏光に係る強 度分布を示している。)、そして、GLV5の照射面 (線状領域) における強度分布をそれぞれ概念的に示し

【0074】LDアレイ1の各エミッターからの光線は 基本的には、同じレーザーからの直交関係にある偏光及 50 互いにインコヒーレントであるため、マイクロレンズア

レイ2を用いてコリメートした各光線について、複屈折 性結晶3を用いて図の縦方向(光軸に直交する方向)に ずらして重ね合わせるだけでも、強度分布をある程度は 均一化することが可能である。

【0075】しかしながら、GLVを使ったレーザーデ イスプレイ等の用途において、このような構成ではシュ リーレンフィルタリングを考えた場合に充分でないとい う事情がある。

【0076】LDアレイについて高出力化するために は、LDアレイにおける発光領域を活性層方向について 数十μm(ミクロン)乃至数百μmにすることが求めら れる。ここでは仮にエミッターの発光領域幅を50μm とする。マイクロレンズアレイの焦点距離を1.5mm (ミリメートル)とすると、光源が理想的な点光源でな く大きさをもつことから、コリメート後の光線は±0. 95 程度の分布幅をもつことになる。従って、図3に 示すような構成例のままでは、GLVレーザーディスプ レイ用光学系としては、コントラストの観点から不適切 である(光線角度を小さくするために、ビーム全体を拡 大して、発散角を抑えなければならない。)。

【0077】また、図3の構成では照明領域の各点が少 数のエミッターからの光線によってのみ照明される(つ まり、照射の対象点を特定した場合に当該点での明るさ に寄与するエミッター数が少ない。) ので、スペックル コントラストの低減という観点からも問題が残る。

【0078】従って、LDアレイを用いる場合には、さ らに工夫を必要とする。例えば、GLVへの入射角度を 抑えるには、複屈折性結晶3及びシリンドリカルレンズ 4による集光以前に全体のビームを充分に拡大して発散 を1/4程度にするためにビームを4倍に拡大すれば良 い。また、スペックルコントラストを低減させるには、 後述するように、図3の紙面に垂直な方向に複数のLD アレイを並べて配置するか、あるいは複数のLDアレイ を使って偏光結合により1つのビームが得られるように 構成する必要がある。

【0079】次に、上記したようなビーム群の構成を得 るための具体的手段(光学的手段)について説明する。 【0080】前述したように、光強度についての分割方 法には、(1)偏光を利用した方法と、(2)多重反射 40 による方法とが挙げられるので、両者を組み合わせた方 法を以下に示す。

【0081】図4に示す構成例6では、図示しないレー ザー光源から一本の入射ビーム「1 b」が多重反射板7 (その構成については図17で説明した通りである。) によって等強度とされる6本のビームに分割された後 に、 1/2波長板8を経てさらに複屈折性結晶9を透過 して出力される。

【0082】つまり、本光学系への入射ビームについて

を考慮して充分にコリメートされた平行光であるとして おり、この平行光 (レーザー光) は、多重反射板 7 によ って複数の平行なビームに分割される(図では6本から なるビーム群の例を示す。)。そして、さらにビーム群 は1/2波長板8により適当な方位をもつ直線偏光とし て複屈折性結晶9に入射され、ここで直交する2偏光に それぞれ分割された上で出射する。従って、図示のよう に隣接するビーム同士(例えば、図に示す光線「lt_ p」と「lt_s」)については互いに直交関係をもっ て偏光しているので干渉はしない。しかし、1つおきに 位置するビーム同士 (例えば、図に示す光線「1 t _ p 1」と「lt_p2」) については同じ偏光状態であ り、従って、ビーム間に干渉が生じる結果、強度分布が 不均一になる。

14

【0083】上述したように、ガウシアンビームを仮定 した場合に強度分布を均一化するためには、少なくとも 隣接する3本ずつのビームが干渉なしに重なり合うよう ためのシフト量(図1や図2の横軸方向におけるずれ量 であり、S値に対応する。) を適度に与える必要があ 20 る。

【0084】そこで、図5に示すように、複数のレーザ 一からの光線を、多重反射板に入射させることで複数の ビームに等強度分割し、さらに、それらのビームを、複 屈折性結晶を含む光学系に通してずらした上で重ね合わ せる構成を採用する。

【0085】即ち、この例では、異なるレーザーからの 2本の光線(図5には、「①」、「②」を付して区別し ている。)を用いており、各光線が多重反射板7によっ てそれぞれ分割されてから、 $\lambda / 2$ 波長板8を透過した 角を小さくする。上記した数値例の場合では、角度倍率 30 後に、複屈折性結晶 9 を経た光が p 偏光又は s 偏光とな る(2本の各ビームが多重反射板7により等強度の6本 に分割され、さらに複屈折性結晶9によりp偏光、s偏 光にシフトして分かれるので、2×6×2=24本のビ 一ムが得られる。)。そして、出射光を図6の上から順 番に並べると、例えば、「◐p、Дp、◐s、Дs」 (「①、②」は由来するそれぞれのレーザー光を示し、 「p」はp偏光、「s」はs偏光をそれぞれ示す。)を 1周期としたビーム配置が繰り返されることが分かる。 従って、例えば、「◐p」のビームを中心位置に設定す ると、その直ぐ脇(第一隣接域)には「②s」又は「② p」のビームがきて、その両脇(第二隣接域)には「① s」のビームが位置する。そして、さらにその両脇 (第 三隣接域)には「②p」又は「②s」のビームが位置す るので、中心のビーム(**①**p)に関して当該ビームとそ の両側に隣接するそれぞれ3本のビームとが干渉しない ことは明らかである。

【0086】このように、図5には、隣接する左右3本 のビームが、異なるレーザーからの光線及び直交する2 偏光の組み合わせによって実現される場合の構成につい は、上記したシュリーレンフィルタリングに関する事情 50 て一例を示しており(前記のN乃至N-4の範囲に示し

たビーム配置を周期的に繰り返したのと同じ配列にな る。)、あるビームを関して所定のビーム本数以内の範 囲ではビーム同士が干渉することがなく、当該範囲にお いて各ビームを重ね合わせることができる。

【0087】以上のように、偏光による強度分割、多重 反射による強度分割、そして複数のレーザーからの光を 用いることについて、それらの組み合わせにおいて注意 しなければならないのは、ビーム間にギャップが生じる か否かということである。即ち、多重反射板だけを用い ても、これにより生成される複数のビーム間には、ギャ 10 ップが不可避的に生じるため、空間的にビームを密に配 置するためには複屈折を用いることが必要である。ま た、複数のレーザーからのビームを用いる場合には、ギ ャップを埋めるためにそれぞれのレーザー光を偏光合波 する必要がある。

【0088】また、強度分布について効率良く均一化す るためには、前述したように多数のビームが必要となる が、ビーム本数を増やすことが目的ならば多重反射を用 いた方がコスト的に有利であり、設計の自由度も高い。 つまり、複屈折による分離は、直交する2偏光への分離 20 に限られることが問題となるが、勿論、複数のサバール 板を用いてこれを多段に重ねた配置を採ることも可能で ある。

【0089】図6は、サバール板を多段(本例では2 段)に配置した構成例10を示したものであり、2本の レーザー光は、λ/2波長板11、サバール板12を透 過した後、さらに 1/2波長板13、サバール板14を 透過してから重ね合わされる。尚、図の下方には、破線 で示す位置での偏光状態(偏光方向)について両矢印で 示しており(レーザー光の一方だけについて示す。)、 1/2波長板11を通って偏った光がサバール板12に より直交関係の2偏光にシフト分離され、さらに、これ らが1/2波長板13を通ることで偏ってからサバール 板14により直交関係の2偏光にシフト分離されるの で、ビーム1本当たり4本のビームが得られることにな る。

【0090】本例では、サバール板14から出射される 各ビームについて、第一のレーザー光に由来するものを 「①」、第二のレーザー光に由来するものを「②」で区 別し、p偏光、s偏光をそれぞれ「p」、「s」で区別 40 することにすると、例えば、上から順に「Др、Дѕ、 ②p、②s」をビーム配置が繰り返されることが分かる (従って、あるビームを中心としてこれに隣接する3本 のビームと、中心のビームとが干渉しない関係にあ る。)。

【0091】但し、サバール板の厚みや枚数の増加は、 実用的見地からはあまり魅力的でないため、図5に示す 構成のように、多重反射と複屈折とを組み合わせた構成 が、実用上最も有効な手段と考えられる。勿論、さらに 高出力化を必要とする場合等においては、これに加え 50 【0097】また、複数のレーザーを個別に並列配置さ

て、偏光合波を含めた複数のレーザー光の使用が有効で あることに変わりはない。

【0092】例えば、高輝度化のために、2台以上のレ ーザーを用いる場合の照明装置の構成例15について図 7に示す(尚、多重反射板7及びそれ以降の構成につい ては、複屈折性結晶9の後段にシリンドリカルレンズ1 9、さらにはGLV20が配置されている点を除いて、 図5の構成と同じである。)。

【0093】本例では、第一のレーザーからの光1b1 及び第二のレーザーからの光1b2が偏光ビームスプリ ッター(PBS)16を介してプリズムミラー18の頂 角部に照射され、当該ミラーでの反射により光路変更を 受けた光が多重反射板7に入射される。また、第三のレ ーザーからの光1b3及び第四のレーザーからの光1b 4が偏光ビームスプリッター(PBS)17を介してプ リズムミラー18に照射され、当該ミラーで光路変更を 受けた光が多重反射板7に入射される。従って、図5と の関係においてはプリズムミラー18からの一方が①の ビームに相当し、他方が②のビームに相当する。

【0094】このような偏光ビームスプリッターによる 偏光合波や、ミラーによる合波等を用いて、(強度分布 変換系への入射以前に) ビームの合波を行えば良い。勿 論、3本以上の異なるレーザーからの光線について合波 の後に、上記の場合と同様に多重反射板にビームを入射 させても良いが、その際にはできるだけインコヒーレン トな光線同士を重ね合わせることでスペックルコントラ ストを低減するために、図7の構成と同様なビームの合 波を経た後で多重反射、さらには複屈折による分割を行 うことが望ましい。

【0095】尚、図7では説明の便宜上、2台以上のレ ーザーについて同じ平面上に配置されるものとしたが、 図の紙面に対して垂直な方向に複数のレーザーを並設す るといった各種の形態が可能である。また、図7では、 GLV20(の線状領域)への照明を行うために、その 前段のシリンドリカルレンズ19を用いて複屈折性結晶 の透過後の光を集光している。そして、ビームスプリッ ター等の合波手段については適宜組み合わせて用いるこ とができる。

【0096】本発明に使用するレーザー光源について は、特定のものに限定されないので、様々なレーザーを 想定することができるが、ガウシアン分布のレーザー光 を念頭においた場合には、例えば、固体レーザー、ファ イバーレーザーあるいはその波長変換を利用したものが 挙げられる。特に、ファイバーレーザーを使う場合に は、高出力でコンパクトであること、そして、基盤(シ リコン基板等)上に作成されたV溝アレイを用いて、出 射端について受動的にアライメントができる(つまり、 各ビームの相対的位置関係を設定できる)ので、本発明 のレーザー光源として適している。

せる形態と、半導体レーザーアレイのように複数のレー ザービームを得る形態が挙げられる。後者の場合には、 例えば、マイクロレンズアレイによりコリメートされる LDアレイの使用が挙げられるが、この場合、半導体レ ーザーの各エミッターの強度がガウシアン分布をもつこ とが望ましい。ブロードエリア(発光領域幅が数十乃至 数百μmとされる。)のエミッターの場合には、強度分 布が多モードであることや、多重反射時における光線の 広がりによる、不均一性が問題となるので、それに対す る補正(例えば、多重反射板における各コーティング領 10 域の反射率等を適正に設定して補正する等。) が必要と なる。よって、その分、設計や製造が複雑になるが、上 記したビームの重ね合わせによる平均化自体は一般に通 用する原理であるため、ガウシアン分布から外れた分布 (例えば、分布関数が「exp (-x^k)」 (k≠2) の場合)、あるいは不規則な強度分布をもつ光源の使用 に対しても、ある程度有効に働くことが期待できる。ま た、多数のレーザーを並列化した配置で用いる場合に は、個体間の平均化の効果も得られるため、全レーザー についての強度和として応用上あるいは実用上許容し得 20 る範囲内であれば、特にガウシアン分布にこだわる必要 はない。

[0098]

【実施例】次に、具体的な実施例について説明する。

【0099】先ず、YAGレーザーの第二高調波(波長 532nm) のレーザーを8台使用し、各レーザーの出 力はいずれも等しくて、そのビーム径(直径)を1mm とする。8台のレーザーからの光については偏光合波に より、2台ずつのレーザー光を1つに合波すると、4本 のビームを得ることができる。従って、図7の構成に示 30 のようになる。 すように第一乃至第四のビーム 1 b 1 ~ 4を同一平面内 で配置しても良いが、ここでは、4つのビームのうち、 2つ(以下、これらを「ビーム3」、「ビーム4」と記 す。) については図7の紙面に垂直な方向から照射され るように配置する。残る2つのビーム(以下、これらを 「ビーム1」、「ビーム2」と記す。) については図7 と同様に紙面内の配置とする。

【0100】以下では、説明の簡単化のためにビーム 1、2についてのみ説明する(::下記の説明においてビ ーム3、4の場合に適宜に置換しても基本的な内容は同 40 じことであるから。)。

【0101】複屈折の利用においてはサバール板を用い ることにして、当該サバール板を出射した後のピームの 中心間隔が1.3mmとなるように(前記したS=1. 3の場合に相当する。)、多重反射板とサバール板の組 み合わせについて設計する。

【0102】サバール板を出射した後のビーム群につい ては、サバール板の厚みを薄くして低コスト化できるよ うに、ビーム配置に関して、ビーム1の常光線、ビーム の順に並べることにする。

【0103】先ず、ビーム1とビーム2は、前記プリズ ムミラー18での反射後に、ビーム間隔2.6mmをも って平行な関係になるように調整する。それぞれのビー ム径が 1 mmであるから、プリズムミラーの頂角側での 損失については当該頂角近傍での面取りを含めても充分 に小さく抑えることができる。

【0104】サバール板として方解石を用いるとする と、前記 [数1] 式から、1. 3mmの偏光分離量を得 るための厚みを計算することができ、約11. 3 mmを 得る。尚、ここで、サバール板の光学軸は、入射面法線 に対して45°傾いているとしている。

【0105】次に、多重反射板の設計に移るが、当該反 射板内部での反射後に出射される各ビームは、ビーム間 隔 d = 5. 2 mm(= 1. 3 mm×4)をもってシフト している必要がある。平行平板を構成する基盤の厚みを 「t」とし、屈折率を「n」とするとき、スネルの法則 と簡単な幾何学的関係の考察から下式が得られる。

[0106]

【数5】

 $\sin a = n \cdot \sin b$ $2t \cdot \tan b \cdot \cos a = d$

【0107】図8は、上式の導出について要部を示すも のであり、「a」が入射角を示し、「b」が屈折角を示 す。尚、上式の第二式は、図の点P1及びP2を結ぶ線 分の長さにcosaを掛けたものがdに等しいことから 得られる。

【0108】上式を連立させてtについて解くと、下式

[0109]

【数6】

$$t = \frac{d}{\sin 2a} \cdot \sqrt{n^2 - \sin^2 a}$$

【0110】尚、[数6]式の関係について一例を示し たものが図9であり、横軸に入射角「a」(単位:degr ee(゚))をとり、縦軸に厚み「t」(単位:mm)をと って両者の関係を示している。

【0111】基盤材料として、BK7 (n=1.519 47)を用いることにし、厚みt=10mmとすると、 入射角 a = 24. 7°とすればよいことが数値計算から 分かる(図9参照)。また、このときの屈折角は b ≒ 1 5.96°である。尚、実際の基盤厚みについては誤差 をもつが、これについては基盤への光の入射角度を調整 することで補償が可能である。

【0112】以上の幾何学的関係を考慮して、最終的に 等強度の6本のビームを得るには、図10に示すように 多重反射板の各領域について反射コーティング処理を施 せば良い。即ち、図の左方に示す入射面側については、 1の異常光線、ビーム2の常光線、ビーム2の異常光線 50 2つの領域に区分けして、光線入射用窓部W(幅5.7

19

 $2 \, \text{mm}$)についてはその反射率 $R_0 = 0 \, \text{%}$ とし、全反射面(幅 $2 \, 8$. $6 \, \text{mm}$)の反射率 $R = 1 \, 0 \, 0 \, \text{%}$ とする。そして、出射面側については、各領域の幅をそれぞれ 5. $7 \, 0 \, \text{mm}$ にするとともに、それぞれの反射率については前記 [数 4] 式で求めたように、 $R_1 = 8 \, 3$. $3 \, \text{%}$ 、 $R_2 = 8 \, 0 \, \text{%}$ 、 $R_3 = 7 \, 5 \, \text{%}$ 、 $R_4 = 6 \, 6$. $7 \, \text{%}$ 、 $R_5 = 5 \, 0 \, \text{%}$ とし、また R_6 については $0 \, \text{%}$ とする。

【0113】尚、図10において、各領域については 0.04mmの間隙をもって形成されている(図には、すき間を誇張して示している。)。

【0114】本例において、最終的に得られる照明領域の高さ(幅)は、ビーム間隔×ビーム本数= $5.2 \, \mathrm{mm}$ × $6=31.2 \, \mathrm{mm}$ となり、これはGLVを照明するのに充分な長さである。

【0115】図11は、出射光の強度分布例について概略的に示したものである。

【0116】ビーム1、2のそれぞれの常光線、異常光線は空間的にシフトされた配置を採り、それぞれの強度分布を示す曲線(ガウシアン分布としている。)を図には4種類の線種の違いで区別している。

【0117】隣接するビームについては、そのピーク同士の間隔が1.3mmとされ、また、同種のビームについては、それぞれの間隔が5.2mm(=1.3mm×4)とされている。

【0118】図12はGLVを用いた画像表示装置への 適用例21について構成の概略を示したものである。

【0119】レーザー光源22からの光は、上記に説明した強度分布変換系23(図には単レンズで代表的に示しているが、多重反射板や複屈折性結晶等を含む光学系である。)を介して均一化された上で空間変調器24(例えば、GLV)に照射される。当該空間変調器による回折光は、レンズ25、シュリーレンフィルター26、レンズ27を経た後、投影レンズ系28を透過してガルバノミラー29に達し、さらにはスクリーン30へと到達する。尚、GLVやガルバノミラー等の駆動制御手段については図示及び説明を省略する。

【0120】以上の説明では、各ビームについては偏光合波によるビームと考えたが、偏光合波されたビームに対して、多重反射板の全領域の各反射率が p 偏光と s 偏光に対して等しくなければ、等強度のビームを出射することができない。一般に入射角度が大きくなるとコーティングに要求される精度に関して偏光依存性が大きるで、多重反射板への入射角度をできるだけ小さくすることが望ましい。しかし、図9に示したグラフ曲線からも分かるように、入射角度(a)を小さくすると基盤の板厚(t)が厚くなる。従って、両者の妥協点を模索して、実用上支障を来さない範囲で、入射角度を設定する必要がある。他方、入射角度が小さくなれば、各領域(反射領域)の幅が狭くなることにも注意すべきである。

む必要があるので入射角度をあまり小さくすることはできない。入射面と反射面との間隔を長くとるためには、平行平板の両面に反射コーティングを施す代わりに、各面について独立の基盤を用いることでそれぞれ別体の構成として作成するとともに、各部材の調整を行うという形態も考えられるが、精度出しのために調整を必要とすること及び部品点数が増えること等の事情を考慮すると、偏光合波はできる限り避けて、例えば、図7の紙面に垂直な方向に沿って同じ偏光状態のビームを多数並列に配置する方法が望ましい。

【0121】また、小型化の観点からは、複屈折性結晶の両面にコーティングをそれぞれ施すような構成形態も挙げられるが、複屈折性結晶中の多重反射は複雑であって設計が困難であることや、結晶の耐湿性や耐温度特性等を考えた場合には、複数回のコーティングを行うことは困難であり、あまり実用的ではない。

【0122】上記した実施例では、使用される全てのビームがほぼ点光源とみなせる固体レーザーの高調波 (SHGによる第二高調液) であるため、充分なコリメーションが可能である。つまり、全てのビームを互いに平行な光とすることができる(平行度が高い)ので、GLVに係るシュリーレンフィルタリング後のコントラストにおいても良好な特性を得ることが可能になる。

【0123】尚、複数のレーザーを用いる場合に、各レーザーの出力が大きく相違すると、全てのビームを合成した後で強度分布に不均一性が生じることになる。そこで、これに対する補正を行えるように、例えば、各レーザーについて出力の調整をそれ自身で電気的に行えるようにするか、あるいは各レーザーの外部に強度調整のための手段を設けること、例えば、外部にレーザーの透過光の強度を調整するための手段等を講じることが望ましい。このような外部に設けられる出力調整手段としては、例えば、レーザー光が直線偏光である場合に、2分の1波長板と偏光子とを組み合わせる形態等が挙げられる。

【0124】以上の説明では、GLVのように1次元の空間変調器を想定して、線状領域に対して均一な照明を行う場合について述べてきたが、2次元の空間変調器等への照明を行う場合にも本発明を適用することができる。即ち、1次元照明用に設けられた多重反射板とは別に、もう一枚の多重反射板を使って、多重反射が図5や図7の紙面に垂直な方向においても行われるように構成すれば、2次元への拡張は容易である(面的な広がりをもってビームの重ね合わせを行える。)。勿論、このことは、方位を変えたサバール板をもう一枚用いて、2次元に拡張しても同じことである。

して、実用工文庫を来さない範囲で、人射角度を設定す 【0125】しかして、上記した構成によれば、スペッ る必要がある。他方、入射角度が小さくなれば、各領域 クルノイズや干渉ノイズが十分に抑圧された均一な照明 (反射領域)の幅が狭くなることにも注意すべきであ を、2台以上のレーザーを用いて高い効率をもって実現 る。現実的には、各領域の間には多少のマージンを見込 50 することができる。しかも、構成が比較的簡単であるた

めに、装置の小型化やコスト低減に好適である。例え ば、上記した照明装置を画像表示装置に適用すること で、色再現性に優れた高品位画像の表示が可能なレーザ ーディスプレイ等を実現できる。

[0126]

【発明の効果】以上に記載したところから明らかなよう に、請求項1や請求項7に係る発明によれば、分割され た等強度のビームに対して、複屈折を用いて各ビームを 空間的にずらして、可干渉性をもたないビーム同士を重 ね合わせることによって、均一性に優れた照明光を得る ことができるので、高効率化やスペックルの低減等が可 能になる。そして、非球面シリンドリカルレンズ等を必 要としない比較的簡易な構成で済むため、小型化及び低 コスト化に適している。

【0127】請求項2や請求項8に係る発明によれば、 多重反射板を用いることでビーム分割数を多くすること ができ、低コスト化の面でも有利である。

【0128】請求項3や請求項4に係る発明によれば、 ビーム群について空間的に規則的な配置をとることがで き、また、中心位置のビームが、それと隣接関係にある 20 別のビームと干渉しないように配列させることで、均一 化及びスペックルコントラストの低減に有効である。特 に、異なるレーザーからの光及び異なる偏光状態の光を 用いることにより、各種のビーム配置を採ることができ るので、設計上の自由度が高い。

【0129】請求項5に係る発明によれば、半導体レー ザーアレイからの出射後に、マイクロレンズアレイによ りコリメートされた光を利用でき、コンパクトで簡素な 構成にすることができる。

【0130】請求項6に係る発明によれば、ビーム半径 30 【図14】光学系の要部を示す説明図である。 とビームの中心間隔との関係を適切に設定することによ り、ビーム間に強度の不均一性が生じないようにし、か つ、重ね合わせ後の強度分布において均一な部分の幅が 狭すぎないようにすることができる。

【0131】請求項9や請求項10に係る発明によれ ば、GLVを用いた画像表示装置への適用において、高 輝度化やコントラスト及び画質の向上を実現することが できるので、髙品位化に適している。

【図面の簡単な説明】

ることで得られる強度分布についての説明図であり、本 図は、ビーム半径に対して、2倍、1.5倍、1.4

倍、1. 3倍、1倍のビーム中心間隔をもつ場合につい て示す。

【図2】ビーム半径に対して、2倍から1倍まで0.2 刻みでビーム中心間隔を変えていった場合について示す 図である。

【図3】半導体レーザーアレイとマイクロレンズアレイ を用いた構成についての説明図である。

【図4】図5とともに多重反射板と複屈折性結晶を用い た強度分布変換光学系の構成例を示すものであり、本図 10 はビーム数が1つの場合を示す。

【図5】ビーム数が2つの場合について一例を示す図で

【図6】サバール板を多段構成とした例を示す図であ る。

【図7】 照明装置の構成例を示す図である。

【図8】図9、図10とともに多重反射板の設計例につ いて説明するための図であり、本図は諸元について幾何 光学的な関係を示す説明図である。

【図9】入射角度と基盤厚との関係を例示したグラフ図 である。

【図10】多重反射板における各部の反射率について説 明するための図である。

【図11】出射光の強度分布について説明するための図 である。

【図12】画像表示装置の構成例を概略的に示す図であ

【図13】図14とともにシュリーレンフィルター光学 系について説明するための図であり、本図は光学系を概 略的に示す斜視図である。

【図15】ビーム走査による均一化法について説明する ための図である。

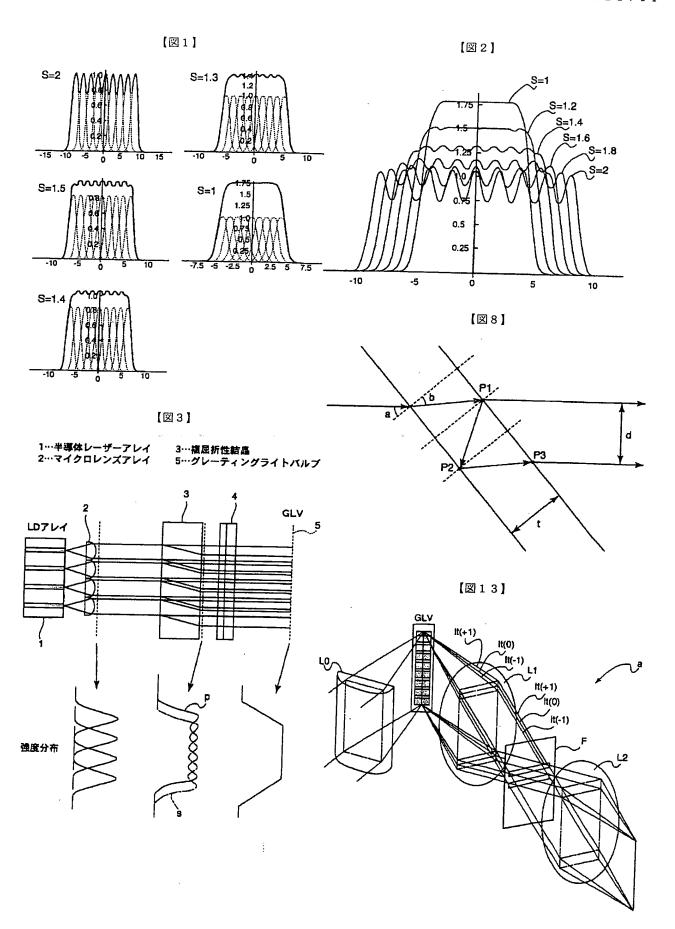
【図16】偏光による強度分割法について説明するため の図である。

【図17】多重反射による強度分割法について説明する ための図である。

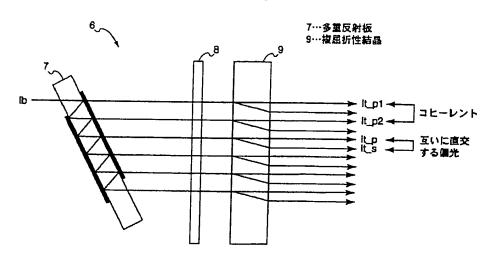
【符号の説明】

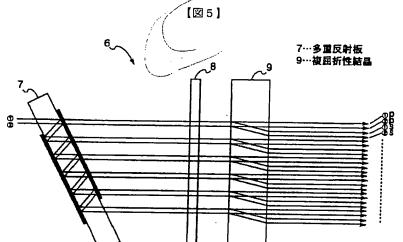
1…半導体レーザーアレイ、2…マイクロレンズアレ イ、3、9、12、14…複屈折性結晶、5、20…グ 【図1】図2とともに、ガウシアンビームを重ね合わせ 40 レーティングライトバルブ、7…多重反射板、15…照 明装置、21…画像表示装置、24…空間変調器

. . .

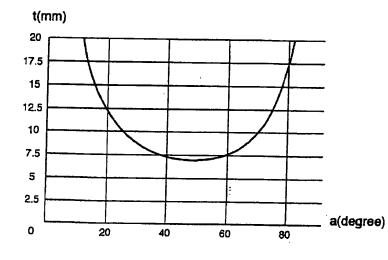






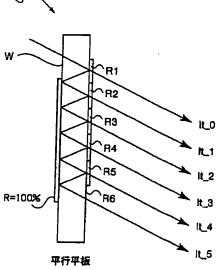


[図9]



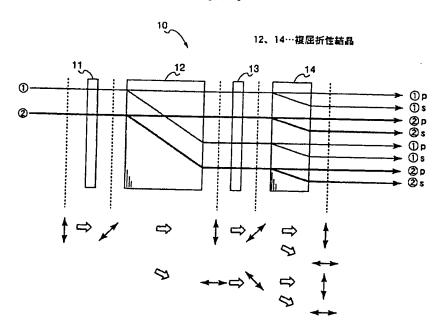
【図17】

(2)多重反射を用いた強度分割

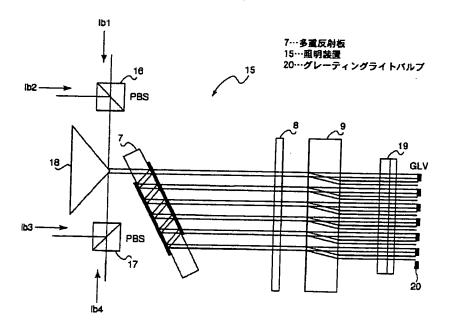


De Debegas .

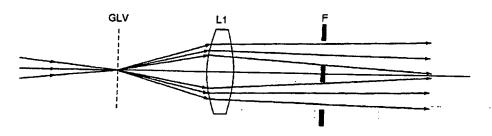
[図6]



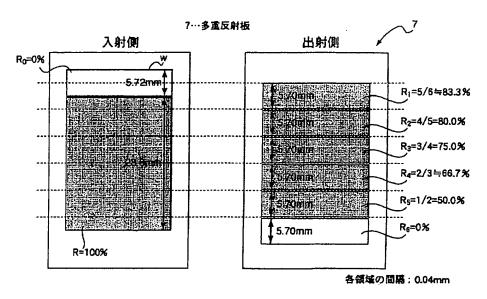
【図7】



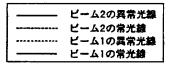
【図14】

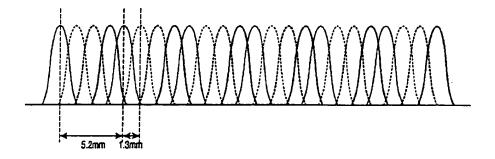


【図10】

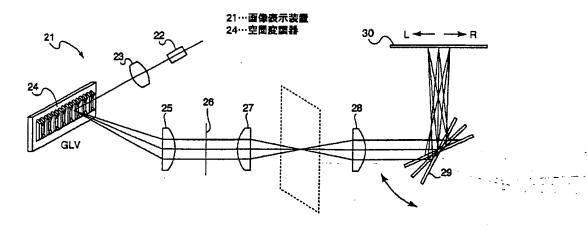


【図11】





【図12】



[図16]

(1)偏光による強度分割

